

TOPICS

1. ご挨拶
2. AI(人工知能)関連発明の特許出願急増中
3. UNITT アニュアル・カンファレンス 2019に参加して
4. 海外知財制度改正情報
5. 日本知財制度改正情報

◇ ご挨拶

最近気温も低くなり、朝晩は過ごしやすくなってきました。今年の夏は昨年ほどの猛暑とはならなかったものの、台風15号での千葉県の大規模停電など自然災害が多く起りました。被害にあわれた方々を心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈りするばかりです。

さて、知的財産の分野に目を向けると、米中貿易摩擦やBrexitなどの議題については、ますます混とんとしてきたというのが正直なところでは、米中間での関税での対抗、応酬が続いています。Brexitで揺れる英国ではEU離脱派の首相に代わりましたが、EUと英国の間での知的財産の具体的な取り決めなどについての話し合いが進んでおらず、「合意なき離脱」となりそうです。大きな混乱がないことを祈るばかりです。



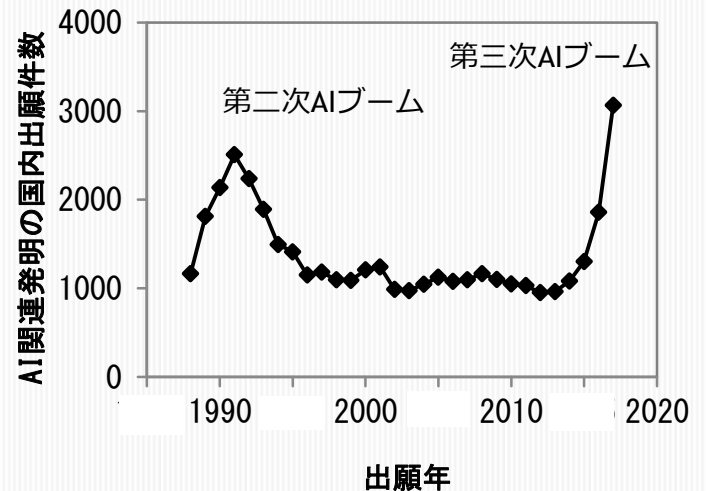
(撮影:小島浩嗣)

◇ AI(人工知能)関連発明の特許出願急増中

AI(人工知能)関連発明の特許出願が、急増しています(右図)。1990年代初頭の第二次ブームから四半世紀を経て、プロセッサの演算性能やメモリの容量が発展し、AIを商用レベルで提供可能なレベルに達したというのが専らの評価です。特許庁の他、WIPO(世界知的所有権機関; 国際出願を管掌する国連の機関)からも調査報告がなされています*1, 2)。

また、日本国特許庁からは、審査事例が紹介されており*3)、どのようなAI関連発明が特許されるかを理解する助けになります。

米国特許庁は、AI 関連発明の特許審査の信頼性・予見性を向上させるための審査ガイドラインの策定是非についてパブリックコメントを募集しています(10月11日〆切)*4)。



データ出所: 「AI関連発明の出願状況調査」特許庁

みなさんのお仕事にもAIを役立てる工夫を考えてみませんか?

* 1) https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

* 2) "Artificial Intelligence", WIPO Technology Trends 2019

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

* 3) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html

* 4) https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2019/20190827.pdf

◇ 海外知財制度改正情報

《米国》

◆海外からの商標出願に対する要件追加

* 1)

米国特許商標庁 (USPTO) は連邦規則を改正し、USPTO に対して行う全ての商標手続は、「米国弁護士の資格を有する者に代理されなければならない」との要件を追加。本規則は08月03日から適用される。

《中国・欧州・香港・台湾・韓国》
特になし

* 1) https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2019/20190703-1.pdf

* 2) Lidout & Maybee LLP 2019/09/14付ニュースレター

《カナダ》

◆改正特許法の施行

大規模な改正を含むカナダ特許法が本年10月30日から施行。特徴として、「PCT出願において、国際出願日が2019年10月30日以降のPCT出願で、カナダ移行出願が30か月を超える場合、延期申請+回復費用200カナダドル支払いにより42か月まで移行を延長可」「優先権の回復」「審査請求期限を4年に短縮」「審査応答期限を4か月に短縮」「2019年10月30日以降、オフィスアクションの応答期限を6か月から4か月に短縮」などの様々なトピックスあり。

◇ 日本知財制度改正情報

我が国では、「令和元年度特許法等改正」がすでに可決されています。現段階で施行日が不明なものもありますが、ポイントを以下にご紹介いたします。* 1)

《特許法》

◆中立な技術専門家による調査制度 (査証)

特許権侵害等の際に、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入って調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設。

◆損害賠償額算定方法の見直し

特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして損害額を請求可能とするなど損害額が上がるように改正。意匠法、商標法も併せて改正。

* 1) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kai_ei_r010517.html

《意匠法》

◆保護対象の拡充

物品に記録・表示されていない画像や建築物の外観・内装のデザインを保護対象に追加。

◆関連意匠制度の見直し

関連意匠の出願可能期間を、本意匠の出願日から10年以内までに延長。関連意匠にのみ類似する意匠の登録を容認。

◆意匠権の存続期間の変更

「登録日から20年」→「出願日から25年」

◆意匠登録出願手続の簡素化

複数の意匠の一括出願を容認。物品の区分を廃止

◆間接侵害規定の拡充

◇ UNITT アニュアル・カンファレンス2019に参加して

2019年9月6-7日、東京電機大学千住キャンパスにおいて、UNITT アニュアル・カンファレンス2019が開催されました。

UNITT(一般社団法人大学技術移転協議会)とは、大学・研究機関及びTLO並びにこれらの活動を支援する機関や個人間のネットワークを形成するとともに、そのネットワーク基盤の上で、大学・研究機関における知的財産管理、技術移転、共同研究及び起業等、広く産業連携の業務を効果的に展開するための交流、相互啓発、調査、研究、提案などを推進する機関です。

(ご参考：<https://unitt.jp/>)

毎年この時期に、知財教育に力を入れている大学を会場として協議会が開催されています。2日間で20の発表が行われ、活発な討議、交流が行われました。筆者(本谷)が当該カンファレンスに参加しましたので、日本弁理士会が提供した「企業内弁理士から見た産学連携の課題と目指すべき方向性」について紹介させていただきます。皆様の会社における産学連携のご参考になれば幸いです。

まず、モデレーターから、政府は「日本再興戦略2016」において、2025年までに産学連携の金額を現在の三倍にするとの目標を定め、大学側及び企業側の施策について提言しているとの紹介がありました。*1)

しかし、モデレーターから、それらの施

策で良いのかと問題提起されました。

企業側のスピーカーからは、「異分野間のマッチングが重要である。」、「教授の研究情報を探るのが容易でない」、「大学における秘密管理が不十分である」等の課題が提示されました。

それに対し、UNITT会員より、「異分野のマッチングをするにはどうすれば良いのか」、「企業がより多くの資金を提供する要素は何か」等の質問が出され、活発な質疑が行われました。

筆者は、最終的には、大学側と企業側の戦略の共有化、教授と企業側実責任者との間の人間関係が提供資金額、及び連携成功の鍵になることを強く感じた次第です。

今後、新製品の効果確認、共同技術開発等、大学等との連携が増えるかと考えますが、ベースは人間関係であることを再認識したいと思います。



弁理士会セッション(2)風景 (筆者撮影)

* 1) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/_icsFiles/afieldfile/2016/12/26/1380114_01_1.pdf

お問い合わせ先

英究特許事務所 小島 浩嗣
mail: kojima@aq-patent.com
<http://www.aq-patent.com/>

※本ニュースレターは、有志の弁理士グループ『Team Lux (チーム・ルクス)』(本谷、藁科、小島)が旬の知財情報の中から、企業の皆さまの知財業務に役立つ情報をピックアップして提供させていただいております。尚、内容についてのご質問、お問合せは、『Team Lux(チーム・ルクス)』のメンバーである配布責任者までお願いいたします。

※ニュースレター『IPLux(アイピー・ルクス)』の名称について

「Lux (ルクス)」はラテン語で「光」の意味です。3ニュースレターが、皆様にとって知的財産(IP; Intellectual Property)に関する一筋の道、一筋の光となるように命名しました。末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。